

Máquina De Horno Tubular Inclinado De Deposición Química Mejorada Por Plasma Pecvd

Número de artículo: KT-PED



Introducción

La máquina de recubrimiento PECVD de KINTEK proporciona películas finas de precisión a bajas temperaturas para LED, células solares y MEMS. Soluciones personalizables de alto rendimiento.

[Aprende más](#)

Soporte de muestras	Tamaño	1-6 pulgadas
	Velocidad de rotación	0-20rpm ajustable
	Temperatura de calentamiento	≤800°C
	Precisión de control	±0,5°C Controlador PID SHIMADEN
Purga de gas	Medidor de caudal	CONTROLADOR DE CAUDALÍMETRO MÁSIKO (MFC)
	Canales	4 canales
	Método de refrigeración	Refrigeración por agua circulante
Cámara de vacío	Tamaño de la cámara	Φ500mm X 550mm
	Puerto de observación	Puerto de visión completa con deflector
	Material de la cámara	Acero inoxidable 316
	Tipo de puerta	Puerta de apertura frontal
	Material de la tapa	Acero inoxidable 304
	Puerto de la bomba de vacío	Brida CF200
	Puerto de entrada de gas	φ6 Conector VCR
Potencia de plasma	Fuente de alimentación	Alimentación CC o RF
	Modo de acoplamiento	Acoplado inductivamente o capacitivo de placa
	Potencia de salida	500W-1000W
	Potencia de polarización	500v
Bomba de vacío	Prebomba	Bomba de vacío de paletas 15L/S
	Puerto de la bomba turbo	CF150/CF200 620L/S-1600L/S
	Puerto de alivio	KF25
	Velocidad de la bomba	Bomba de paletas:15L/s[Bomba turbo:1200L/s]1600L/s
	Grado de vacío	≤5×10-5Pa
	Sensor de vacío	Medidor de vacío de ionización/resistencia/medidor de película
Sistema	Alimentación eléctrica	CA 220V /380 50Hz

Potencia nominal	5kW
Dimensiones	900mm X 820mm X870mm
Peso	200kg